

나노종합기술원 "12인치 반도체 공정" 장비 이용료 기준표 (2024년. 10월1일)

※ 장비이용료는 공정조건에 따라서 차이가 발생할 수 있습니다.

| 번호 | 연구 장비 | | 장비이용료 기준 | | 재료비 | 비고 |
|----|--|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|--|---|
| | 장비명(모델명) | 공정 및 조건 | 이용자 직접 진행 | NNFC 담당자 진행 | | |
| 1 | ArF immersion (ASML, XT1900Gi) | Expoure | | 1,575,000원/기본료+263,000원/wf | | . Special 공정조건 별도 |
| 2 | Track (TEL, Lithius-Pro-i) | Coating + Development | | 210,000원/기본료+32,000원/wf | * PR: 100,000원/wf * BARC: 100,000원/wf | |
| | | Spin-Hardmask (SOC) | | 210,000원/기본료+32,000원/wf | * 100,000원/wf (SOC) | |
| | | Spin-Hardmask (Multi-Function) | | 210,000원/기본료+32,000원/wf | * 100,000원/wf (MF) | |
| 3 | CD SEM (Hitachi, CG6300) | CD Measurement | | 420,000원/회/60분 | | |
| 4 | Dry Etch (Dielectric/Si/Metal/etc) | Non pattern Etch | | 210,000원/기본료+210,000원/wf | | . Etch Depth 1um 초과 별도 . 공정시간(RF On Time) 5분 초과 별도 . Special Material/Wafer, Plasma 내식성 평가 별도 |
| | | pattern Etch | | 210,000원/기본료+315,000원/wf | | |
| | | Special Pattern & Material Etch | | 210,000원/기본료+420,000원/wf | | |
| 5 | PR Strip (PSK, SUPRA N) | PR ashing | | 42,000원/기본료+ 42,000원/wf | | . 공정시간(RF On Time) 5분 초과 별도 |
| 6 | Oxidation (TERA, 300SE) | Thermal oxidation | | 1,103,000원/ 1FOUP | | . 두께 2,000A 기준 . 두께 2,000A 이상 : 100,000원/1000A 추가 |
| | | Anneal | | 1,103,000원/ 1FOUP | | . 5시간 이상 별도 |
| 7 | LPCVD (DJ-1224VN) | Nitride | | 1,607,000원/ 1FOUP | | . 두께 1,000A 기준 . 두께 1,000A 이상 : 500,000원/1000A 추가 |
| 8 | Single wafer cleaner (PSM-302) | SC-1 Clean | | 53,000원/wf | | . 시간 120sec 이상 : 53,000원 추가 /120sec . BOE 재료비: 10,000원/Wafer |
| | | DHF Clean | | 53,000원/wf | | |
| | | BOE(LAL 15) Clean | | 53,000원/wf | | |
| | | DSP Clean | | 53,000원/wf | | |
| 9 | PECVD (AMT, Producer SE) | Oxide (≤ 1.5μm) | | 221,000원/wf | | . 두께 1.5μm 이상 : 221,000원 추가 /1.5μm . 두께 0.5μm 이상 : 221,000원 추가 /0.5μm |
| | | Nitride (≤ 1.5μm) | | 221,000원/wf | | |
| | | Oxynitride (≤ 1.5μm) | | 221,000원/wf | | |
| | | TEOS (≤1.5μm) | | 221,000원/wf | | |
| | | ACL 500nm 이하 | | 221,000원/wf | | |
| 10 | HDPCVD (AMT, Ultima-X) | HDP USG (≤ 1.0μm) | | 221,000원/wf | | . 두께 1.0μm 이상 : 221,000원 추가 /1.0μm |
| 11 | Spectroscopic Ellipsometer (KLA, SFX-200) | Film Thickness Measure | 105,000원/기본료+42,000원/wf | 137,000원/기본료+53,000원/wf | | . 10장까지 / 13Point 기준 |
| 12 | Defect Inspection System (AEGIS-DP) | Job file(Recipe creation) | | 525,000원/RUN | | |
| | | Particle 측정 | | 210,000원/wf(10분) | | |